(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



## . 1 DED CHILDER HEIDE HEID BEIDE GEREN BEIDE HEID BEIDE HEIDE HEID

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 3. März 2005 (03.03.2005)

PCT

## (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/019878 A1

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: G02B 5/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/007186

(22) Internationales Anmeldedatum:

2. Juli 2004 (02.07.2004)

(25) Einrelchungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 103 35 215.5 1. August 2003 (01.08.2003) DE

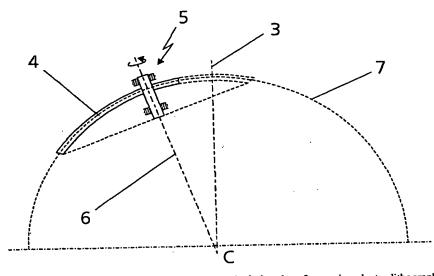
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): CARL ZEISS SMT AG [DE/DE]; Carl-Zeiss-Str. 22, 73447 Oberkochen (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BIEG, Hermann [DE/DE]; Faber du Faur Str. 2, 73433 Aalen (DE).

HUBER, Martin [CH/CH]; Bahnhofstr. 26, CH-5000 Aarau (CH). HENZELIN, François [CH/CH]; Rue des Fontenattes 12, CH-2926 Boncourt (CH). BISCHOFF, Thomas [DE/DE]; Adenauerstr. 4, 73433 Aalen (DE). GELLRICH, Bernhard [DE/DE]; Schnaitbergstr. 3, 73434 Aalen (DE). SZEKELY, Gerhard [CH/CH]; Herbstweg 26, CH-8050 Zürich (CH). NGUYEN, Uy-Llem [GB/CH]; Zelgweg 26, CH-5405 Baden (CH).

- (74) Anwalt: LORENZ, Werner; Alte Ulmer Str. 2, 89522 Heidenheim (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: OPTICAL IMAGING DEVICE COMPRISING AT LEAST ONE SYSTEM DIAPHRAGM
- (54) Bezelchnung: OPTISCHE ABBILDUNGSVORRICHTUNG MIT WENIGSTENS EINER SYSTEMBLENDE



(57) Abstract: Disclosed is an optical imaging device (PL), particularly a lens for semiconductor lithography, comprising at least one system diaphragm (1, 1). Said system diaphragm (1, 1) is provided with a plurality of movable lamellae (4, 4) that are rotatably mounted. The lamellae (4, 4) have a spherical curvature.

(57) Zusammenfassung: Eine optische Abbildungsvorrichtung (PL), insbesondere Objektiv für die Halbleiterlithographie, ist mit wenigstens einer Systemblende (1,1') versehen. Die Systemblende (1,1') weist eine Vielzahl von bewegbaren Lamellen (4,4') auf, welche drehbar gelagert sind. Die Lamellen (4,4') weisen eine sphärische Krümmung auf.

DDS/010878 A1